2019/2/20

#### J-PARC muon g-2/EDM検出器に おける冷却システムの開発

#### 総合研究大学院大学

#### 牛澤 昂大태

東北大電子光<sup>A</sup>, KEK素核研<sup>B</sup>, KEK物構研<sup>c</sup>, KEK機械工学セ<sup>D</sup>, 総研大<sup>E</sup>, 東大理<sup>F</sup>, JAXA<sup>G</sup>, 名大理<sup>H</sup>, 九大理<sup>I</sup>, 九大RCAPP<sup>J</sup>, Open-It<sup>K</sup>, IIT<sup>L</sup>, KAIST<sup>M</sup>

青柳泰平<sup>A</sup>,池田博一<sup>G, K</sup>,池野正弘<sup>B, K</sup>,上野一樹<sup>B, K</sup>,内田智久<sup>B, K</sup>,Oh Jeawhan<sup>M</sup>,川越清以<sup>I</sup>, 岸下徹一<sup>B, K</sup>,久米達哉<sup>D</sup>,高力孝<sup>B, K</sup>,齊藤直人<sup>B</sup>,佐々木修<sup>B, K</sup>,佐田智也<sup>I</sup>,佐藤伸彦<sup>D</sup>,佐藤優太郎<sup>B, K</sup>, Jangam Viraj<sup>L</sup>,庄子正剛<sup>B, K</sup>,調翔平<sup>I, K</sup>,末原大幹<sup>I, K</sup>,須江祐貴<sup>H</sup>,須田利美<sup>A</sup>,千代浩司<sup>B, K</sup>,高富俊和<sup>D</sup>, 田中真伸<sup>B, K</sup>,塚田暁<sup>A</sup>,堤裕樹<sup>I, K</sup>,東城順治<sup>I, K</sup>,南波和希<sup>A</sup>,西村昇一郎<sup>C, K</sup>,本多佑記<sup>A</sup>,眞玉将豊<sup>I, K</sup>, 三部勉<sup>B, K</sup>,村上武<sup>B, K</sup>,安田浩昌<sup>F, K</sup>,山中隆志<sup>J, K</sup>,吉岡瑞樹<sup>J, K</sup>,他J-PARC muon g-2/EDMコラボレーション

# ミューオン g-2/EDM

g-2

標準理論を超えた物理の探索方法の一つとして、ミューオンの異常磁気能率 (g-2)の 精密測定が行われている。



アメリカのBNLの実験では、 理論予想値[1]より3.7σの大きいミューオン のg-2の値が測定されている。 →新物理の兆候であるのか議論されている。

[1] A. Keshavarziet al., Phys. Rev. D 97 (2018) 114025

#### EDM

電気双極子能率(EDM)は電場におけるハミルトニアン (右式)の関係から、時間反転対称性を破る。 →CPT定理から有限のEDMはCP対称性の破れの証拠。



## ミューオン g-2/EDM精密測定

g-2

 スピン方向の時間変化と磁場の大きさから歳差運動の角周波数を計測し、g-2の 値を決定する[2]。



- μ+は崩壊時にスピン方向へ高い運動量の陽電子が放出する。
- 高い運動量の陽電子を計測することでスピンの方向を検出できる。

#### EDM

• EDMの測定は磁場の向きに対しての平行・反平行の 非対称度を測定。

[2] arXiv:1901.03047



J-PARC muon g-2/EDM実験の概要

-PARC muon g-2/EDIVI 美級の做去  

$$\vec{\omega} = -\frac{e}{m} \begin{bmatrix} a_{\mu}\vec{B} \\ a_{\mu}\vec{B} \end{bmatrix} = \left( a_{\mu} - \frac{1}{\gamma^{2} - 1} \right) \frac{\vec{\beta} \times \vec{E}}{c} + \frac{\eta}{2} \left( \vec{\beta} \times \vec{B} + \frac{\vec{E}}{c} \right) \begin{bmatrix} n \\ n \\ n \end{bmatrix}$$
BNL/Fermilab :  $(a_{\mu} - \frac{1}{\gamma^{2} - 1}) = 0$ となる $\gamma(\vec{\gamma} \cdot \vec{\gamma} \cdot \gamma \cdot \gamma \cdot \gamma)$ を使用。  

$$a_{\mu} \equiv \frac{g - 2}{2}$$



	BNL / Fermilab
ミューオン運動量	3.09 GeV/c
蓄積リングの直径	14 m
磁場強度	1.45 T

BNL

BNL/Fermilab:陽電子検出にカロリメータを使用。





- BNL/Fermilab :  $(a_{\mu} \frac{1}{\nu^2 1}) = 0$ となる $\gamma$ (マジック $\gamma$ )を使用。
- BNL J-PARC J-PARC w =  $\frac{e}{m} \begin{bmatrix} a_{\mu} \vec{B} \\ a_{\mu} \vec{B} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} a_{\mu} \frac{1}{\gamma^{2} 1} \end{pmatrix} \frac{\vec{\beta} \times \vec{K}}{c} + \frac{\eta}{2} \begin{pmatrix} \vec{\beta} \times \vec{B} \\ \vec{\beta} \end{pmatrix} \end{bmatrix}$ クィ)を使用。 a<sub>µ</sub> =  $\frac{g 2}{2}$ J-PARC:電場を用いず弱収束磁場でミューオンビームを蓄積する。(E=0)
  - 極冷ミューオンを用いた低エミッタンス (1π mm・mrad)ミューオンビーム (世界初の ミューオン加速器) **→中沢さんが説明(次の発表**)



	BNL / Fermilab
ミューオン運動量	3.09 GeV/c
蓄積リングの直径	14 m
磁場強度	1.45 T

BNL/Fermilab:陽電子検出にカロリメータを使用。





- BNL/Fermilab :  $(a_{\mu} \frac{1}{\nu^2 1}) = 0$ となる $\gamma(マジック\gamma)$ を使用。
- BNL J-PARC J-PARC w =  $\frac{e}{m} \begin{bmatrix} a_{\mu} \vec{B} \end{bmatrix} + \begin{pmatrix} a_{\mu} & -\frac{1}{\gamma^2 1} \end{pmatrix} \frac{\vec{\beta} \times \vec{K}}{c} + \begin{bmatrix} \eta (\vec{\beta} \times \vec{B} + \frac{\vec{k}}{c}) \end{bmatrix}$ クィ)を使用。 a<sub>µ</sub> =  $\frac{g 2}{2}$ J-PARC:電場を用いず弱収束磁場でミューオンビームを蓄積する。(E=0)
  - 極冷ミューオンを用いた低エミッタンス (1π mm・mrad)ミューオンビーム (世界初の ミューオン加速器) **→中沢さんが説明(次の発表**)



	BNL / Fermilal	J-PARC		
ミューオン運動量	3.09 GeV/c	x 1/10	300 MeV/c	
蓄積リングの直径	14 m	x 1/20	66 cm	
磁場強度	1.45 T	x 2	3 T	

BNL/Fermilab:陽電子検出にカロリメータを使用。



- J-PARC J-PARC が =  $\frac{e}{m} \begin{bmatrix} a_{\mu} \vec{B} \\ a_{\mu} \vec{B} \end{bmatrix}$  ( $a_{\mu} \frac{1}{\gamma^{2} 1}$ )  $\frac{\vec{\beta} \times \vec{K}}{c} + \left[\frac{\eta}{2} \left(\vec{\beta} \times \vec{B} + \frac{\vec{k}}{c}\right)\right]$ クγ)を使用。  $a_{\mu} \equiv \frac{g 2}{2}$ BNL/Fermilab :  $(a_{\mu} - \frac{1}{\nu^2 - 1}) = 0$ となる $\gamma(マジック\gamma)$ を使用。
  - J-PARC:電場を用いず弱収束磁場でミューオンビームを蓄積する。(E=0)
    - 極冷ミューオンを用いた低エミッタンス (1π mm・mrad)ミューオンビーム (世界初の ミューオン加速器) **>中沢さんが説明(次の発表)**



精度:g-2 0.1 ppm (BNL: 0.54 ppm)、EDM 10<sup>-21</sup> e・cmを目指す。

	DNL / Fermilar	)	J-PARC	
ミューオン運動量	3.09 GeV/c	x 1/10	300 MeV/c	
蓄積リングの直径	14 m	x 1/20	66 cm	
磁場強度	1.45 T	x 2	3 T	

DNI / Earmilah

- BNL/Fermilab:陽電子検出にカロリメータを使用。
  - J-PARC:シリコンストリップ センサを用いた飛跡検出器を 使用
    - 陽電子の飛跡の検出に よりEDMを正確に測定。

 カロリメータと比較して パイルアップの区別が行 いやすい。

参考: arXiv:1901.03047

#### 陽電子飛跡検出器

- シリコンストリップセンサ検出器(ベーン)40枚を放射状に設置。
  - ミューオンの崩壊陽電子の軌跡をシリコンストリップセンサを用いて正確に捕捉。
- 検出器は高真空のミューオン蓄積リングの内側に薄い陽電子窓(ポリイミド)を隔てて設置。
  - 気圧差によって生じる陽電子窓へかかる力を考慮して、検出器は真空中(低真空)に設置。



drawn by T. Takatomi (KEK Mechanical Engineering Center), T. Yamanaka (Kyushu University) ICEPP symposium

#### 陽電子飛跡検出器

- シリコンストリップセンサ検出器(ベーン)40枚を放射状に設置。
  - ミューオンの崩壊陽電子の軌跡をシリコンストリップセンサを用いて正確に捕捉。
- 検出器は高真空のミューオン蓄積リングの内側に薄い陽電子窓(ポリイミド)を隔てて設置。
  - 気圧差によって生じる陽電子窓へかかる力を考慮して、検出器は真空中(低真空)に設置。



drawn by T. Takatomi (KEK Mechanical Engineering Center), T. Yamanaka (Kyushu University) ICEPP symposium

#### 陽電子飛跡検出器

- シリコンストリップセンサ検出器(ベーン)40枚を放射状に設置。
  - ミューオンの崩壊陽電子の軌跡をシリコンストリップセンサを用いて正確に捕捉。
- 検出器は高真空のミューオン蓄積リングの内側に薄い陽電子窓(ポリイミド)を隔てて設置。
  - 気圧差によって生じる陽電子窓へかかる力を考慮して、検出器は真空中(低真空)に設置。



#### 検出器の開発状況



Test module 2の特性試験 (閾値依存性、角度依存性)@ELPH

## 検出器の冷却

#### 検出器の主な熱源

- ASIC : 5 mW x 128 ch =0.64 W/chip
- ASICの枚数:16枚x2列=32枚/(1/4ベーン)
- 1/4ベーンあたり:20.4 W

#### 検出器の設置環境

• **真空中(低真空)**に設置





#### 冷却システムの構造



## 接着剤試験

#### 6種の熱伝導性接着剤について熱源の温度に対して相対的に



set up prepared by T. Takatomi (KEK Mechanical Engineering Center)

この測定からTB2270J (スリーボンド、 エポキシ系)を用いて製作することにした。

# 熱源の熱抵抗の見積もり

10

ASIC – 銅板間の**熱抵抗、温度差**の見積もりを行った。 見積もりには以下の計算式を使用。

熱抵抗 $R[K \cdot W^{-1}] = \frac{L[mm]}{\sigma[W \cdot mm^{-1} \cdot K^{-1}] \cdot A[mm^2]}$ 、温度差 $\Delta T[K] = R[K \cdot W^{-1}] \cdot Q[W]$ L:伝熱長(厚み)、 $\sigma$ :熱伝導率、A:伝熱面積、Q:熱量

伝熱面積はASIC(7 mm x 15 mm)を使用



# 熱源の熱抵抗の見積もり

ASIC – 銅板間の**熱抵抗、温度差**の見積もりを行った。 見積もりには以下の計算式を使用。

熱抵抗 $R[K \cdot W^{-1}] = \frac{L[mm]}{\sigma[W \cdot mm^{-1} \cdot K^{-1}] \cdot A[mm^2]}$ 、温度差 $\Delta T[K] = R[K \cdot W^{-1}] \cdot Q[W]$ L:伝熱長(厚み)、 $\sigma$ :熱伝導率、A:伝熱面積、Q:熱量

伝熱面積はASIC(7 mm x 15 mm)を使用



ASIC – 銅板間では9.6 Kの温度差が生じる。

# 熱輸送部の評価

- 実際の冷却システムの読み出し回路裏表1列分 (ASIC x 16個 x 2)を模した試験機を製作し、 次の事項について調査する。
- ヒートパイプの熱輸送の効果
- ASIC表面温度の測定







#### 熱源の作成

- **実機スケール**に近づけ製作
- 接着はTB2270Jを使用。

# 熱輸送部の評価



11

<sup>2019/2/2</sup> 

### 熱輸送部の評価方法

- 冷却水の温度制御を冷却水循環装置(チラー)で行う。
- 赤外線カメラでも測定が行えるように黒体塗料を塗布。
- ヒーターには定電流を流しASICの熱を再現。





銅板(2.0 mm)

manufactured by T. Takatomi (KEK Mechanical Engineering Center)

• 3本のヒートパイプをグリス(熱抵抗:4.9 x 10<sup>-3</sup> K·W<sup>-1</sup> (厚み:0.2 mmを仮定)) 塗布後、ヒーターで挟み、クリップで固定。 温度測定箇所

温度測定箇所

- 熱電対は銅板(2.0 mm)にネジ止め
- 気圧3.9 x 10<sup>-4</sup> atmにて評価





**ICEPP** symposium

12

#### 温度差の測定

13

- ヒーターに10Wを流して6時間測定を行い最終到達温度を銅板(2.0mm)上の点 について調べた。
- コンディション: 点N 点C 銅板 (2.0 mm) 31.5 ℃ 室温:21.8~22.4 °C 29.6 °C 30.4 °C 19.8 °C • 湿度: 55% • 水温: 20°C Temperature difference ASICを模したヒーター °, ∆ 71/ ° 点Fの温度差変化 15 点**C**の温度差変化 10 ヒートパイプ 点Nの温度差変化 冷却水 10 15 20 Power /W

電力Q=10W導入時、ヒートシンク上と銅板上では最小で、14.7Kの温度差 ΔTが生じた。

→左図より、銅板 – ヒートシンクの熱抵抗値  $R = \frac{\Delta T}{Q} = 0.97 [K \cdot W^{-1}]$ →この熱抵抗の内訳を調査した。



電力値を変えそれぞれの点での温度差の平均値を求め、以下の式から熱抵抗を傾きか ら算出した。



### 熱抵抗の冷却水温度依存性

冷却水の温度を20°C, 15°C, 10°C, と変化させたときのヒートパイプ-ヒートシンク間 の熱抵抗の変化を調べた。



熱コンタクトによる抵抗は水温に依らない。 →ヒートパイプの特性が傾きの変化として現れている →ヒートパイプは**冷却水の温度に依存**して熱抵抗値が変化する。



熱源(ASIC) – 銅板間の予測値ΔT<sub>ASIC-Cu</sub>、ヒートパイプ – ヒートシンク間の測定値ΔT<sub>HP-HS</sub> から、ASIC表面上の温度を予想 (20 W)。



- 10 °C ~ 20 °Cの温度においてASIC上で50 °C未満の要件を満たしている。
- 今後は、20度以上でも試験を行いヒートパイプの熱輸送効率変化を系統的に 理解する。
   ICEPP symposium



17

- ミューオンg-2の実験は新物理の探索において重要な実験である。
- J-PARC muon g-2/EDM実験において真空中で動作するASICの冷却システムの開発が必要。
- ASIC-ヒートパイプ間の接着剤
  - FPC-銅板間はTB2270Jを使用する。
- ASIC上で50 ℃未満にするという要件は冷却水 10 °C ~ 20 °Cにおいて満たしている。
- 今後は、20度以上でも試験を行いヒートパイプの熱輸送効率変化を系統的に理解する。

<予定>

- 冷却水20°C以上の温度でヒートパイプの熱抵抗値の変化を調べる。
- ASIC表面上の温度の測定を行う。
- 冷却システムの最終案決定。

2019/2/20

25

#### Back up



それぞれの測定点の温度差

Temperature difference











#### 主に3種の接着剤:

Araldite (AD\*\*\*\*), ThreeBond (TB\*\*\*\*), PrimaBond (EG\*\*\*\*)

The glue-test was used below glues.

	Sample		Curing temp.	Main	conductivity
	number	Sample	[°C]	component	$[W \boldsymbol{\cdot} m^{-1} \boldsymbol{\cdot} K^{-1}]$
-	0	Cu	-	-	390
エポキシ系	1		24		
	2	AD2011	80	ероху	
	3		150		
	4	TB2270J	80	ероху	4.2
	5		150		
シリル系	6	TB1533	24	special polymer※	
シリコーン	7	TB1225B	24	silicone	1.59
エポキシ系	8		24		
	9	EG7655	80	ероху	1.7
	10		150		
	11	EC 7659	80	2.6	
	12	LG/050	150	ероху	5.0

lpha compound silyl group

2019/2/20

thermal

### RMSの決定(熱伝導性接着剤)

dispersion



29





#### ヒートパイプとは





#### <原理>

- 高温部では作動液が蒸発をすることで熱を奪う。
- 低温部では作動液が凝縮し熱を放出。
- 生じた蒸気圧で作動液の蒸気が移動。
- 凝縮した液は内側のウィックの毛細管現象で還流する。



ヒートパイプ中の状態変化